С.Б. Бирючинский

Проекционные оптические системы для литографии 22-26

***Аннотация***

***В работе рассмотрены основные процедуры оптимизации литографического объектива на длину волны 365 нм. Показан вариант системы и даны рекомендации по оптическим расчётам подобных объективов.***

***Ключевые слова: объектив, литография, аберрации.***

PROJECTION OPTICAL SYSTEMS FOR LITHOGRAPHY

S. Biryuchinskiy

***Abstract***

***In paper the basic optimisation procedures of a lithographic objective for length of a wave 365 nm are considered. The author's variant of system is shown and recommendations about optical calculations of similar objectives are made.***

***Keywords: objective, lithograph, aberrations.***

***Литература***

1. *Milton Laikin.* «Lens Design», Fourth Edition, CRC Press, 2006.

2. Патент США 8,314,922 (Nov.20, 2012).

3. *Бирючинский С.Б*. Киносъёмочные стереообъективы высокой чёткости // МТК, 2009,

№ 13. С. 19-22***.***